

平成31年度 ナノテクキャリアアップアライアンス  
京都大学 電子線描画装置アドバンスコース

■目的：

近年、微細加工技術で大いに注目を集めているのが MEMS・NEMS 技術であり、既に様々な分野で研究・開発・実用化が進んでいます。特に、センサ・情報通信・医療・バイオなどの分野で著しい発展をとげています。この技術の中で、微細構造作製におけるキープロセスのひとつが、電子線描画です。

本コースにおいては、微細加工の中級者を対象にし、最新鋭電子線描画装置を使用した Si ウェハへの高度な描画（多層レジスト、重ね合わせ描画等）をメインに、より複雑なデバイス加工に対応した微細加工のための基本技術の習得を目指します。

■募集人数： 3名

■期間： 平成32年3月2日（月）～ 3月12日（木）  
講義：2日間（全員）、実習：2日間（個別） 合計4日間

■会場：

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点  
京都市左京区吉田本町 京都大学吉田キャンパス内 工学部物理系校舎3階327号  
<http://www.nanoplat.cpier.kyoto-u.ac.jp/access/>

■内容：

1日目、2日目 3月2日（月）～ 3月3日（火）

① 電子線描画の基礎から応用（講義） 参加者全員が対象

※以下の日程は受講者毎に連続した2日間を実施します。参加者により日程が異なりますのでご注意ください。  
具体的な受講日程は、受講決定後、調整します。

3日目 3月4日（水）、3月9日（月）、3月11日（水） の何れかの日

- ② CADによる描画パターンデータ作成
- ③ 露光前処理 -レジスト塗布等（実習）
- ④ 多層レジストを用いた描画（実習）

4日目 3月5日（木）、3月10日（火）、3月12日（木） の何れかの日

- ⑤ 高精度重ね合わせ描画（実習）
- ⑥ 描画パターンのSEM観察（実習）

■受講料： 14,000円

■問合せ・申込先：

京都大学ナノ・マイクロシステム工学研究室内 CUPAL 事務局  
( [cupal@nms.me.kyoto-u.ac.jp](mailto:cupal@nms.me.kyoto-u.ac.jp)、電話：075-383-3693 )